

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 实验物理中心

一种利用离子束刻蚀技术抛光微结构侧壁的方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

8

下载

0

收藏

0

作者 张天冲¹; 伊福廷¹; 王波¹; 刘静¹; 张新帅¹

发表日期 2013-09-24

专利号 CN103495907A

公开日期 2014-01-08

源URL [<http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211139>]

专题 高能物理研究所_实验物理中心
高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 张天冲,伊福廷,王波,等. 一种利用离子束刻蚀技术抛光微结构侧壁的方法. CN103495907A.

GB/T 7714 2013-09-24.

[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076](#) 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号